

場發射掃描電子顯微鏡

(Zeiss GeminiSEM 300)

Zeiss GeminiSEM 300 系統是一款高分辨率場發射掃描電子顯微鏡，可提供高達 2,000,000 倍的放大倍率（分辨率：在高真空模式下 15kV 時為 8Å）。此外，它配備了能量色散 X 射線光譜儀（EDX），可以提供結構和元素組成分析。

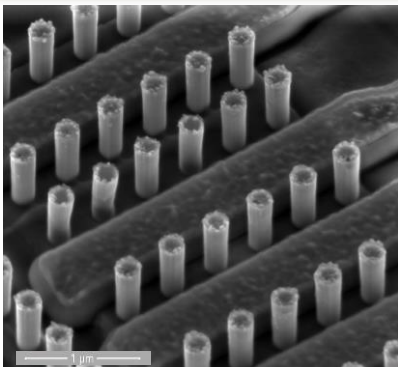


特點和功能：

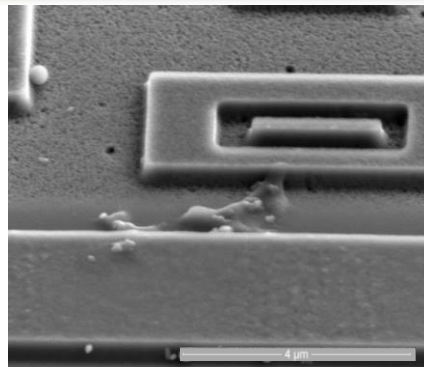
- 配備不同的探測器，BSE，SE，In-lens，STEM，為各種材料提供最佳成像模式
- 配備電荷補償器，允許聚焦電荷補償，消除非導電樣品的充電偽影
- 配備等離子清潔劑，可在分析過程中對樣品進行現場表面清潔。
- 在操作員監督下獲取大量 SEM 圖像並自動執行照片拼接。

應用實例：

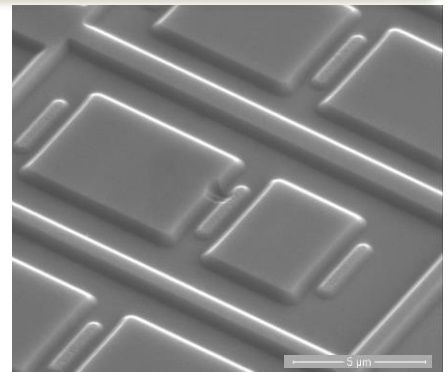
集成電路的表面形貌研究



Contact of Polysilicon layer

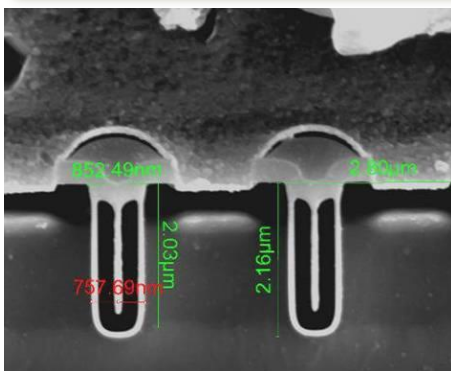


Foreign matter on the substrate

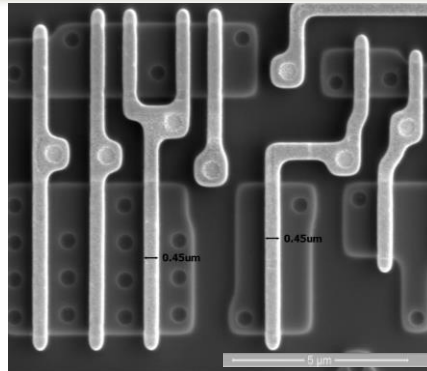


Substrate damaged

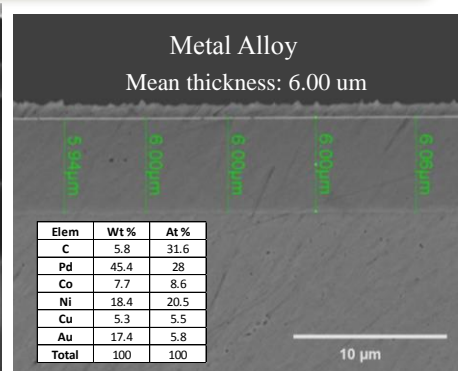
集成電路和薄膜的結構測量和成分分析



Measurement of die structure

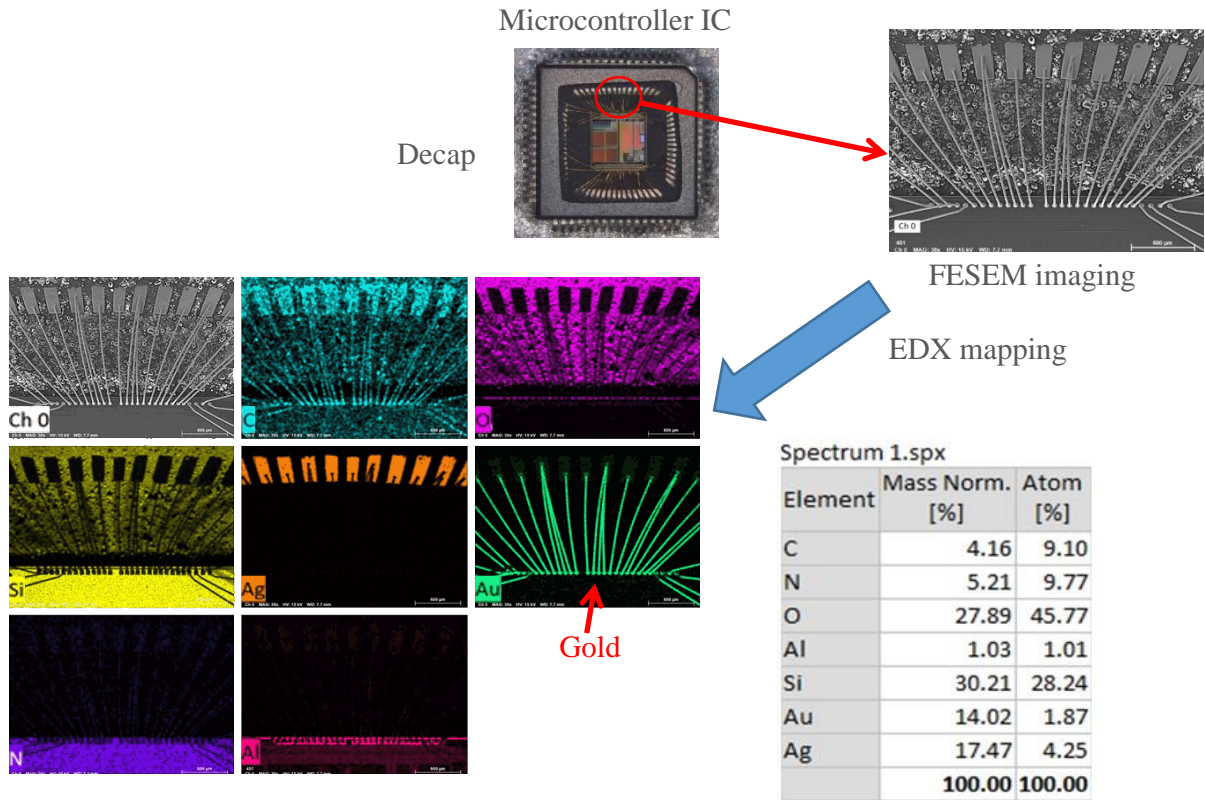


Measurement of Polysilicon layer



Film thickness and composition analysis

EDX 元素分佈分析



802.11ac Wifi & Bluetooth 4.0

